

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成22年11月4日(2010.11.4)

【公開番号】特開2009-71194(P2009-71194A)
 【公開日】平成21年4月2日(2009.4.2)
 【年通号数】公開・登録公報2009-013
 【出願番号】特願2007-240180(P2007-240180)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 1 4 D

H 0 1 L 21/30 5 1 4 E

G 0 3 F 7/20 5 2 1

【手続補正書】

【提出日】平成22年9月14日(2010.9.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体製造装置であって、

処理部と、

前記処理部において使用又は処理される物品を搬送する搬送部と、

キューテーブルと、

前記キューテーブルに基づいて前記搬送部を制御する制御部と、

を備え、

前記キューテーブルには、処理部が実行しているジョブの次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することを制御するための制御情報が登録され、

前記制御部は、前記制御情報に基づいて、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送するように前記搬送部を制御する、

ことを特徴とする半導体製造装置。

【請求項2】

前記制御情報は、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することの可否の情報を含み、

前記制御部は、当該情報に基づいて前記搬送部を制御する、
 ことを特徴とする請求項1に記載の半導体製造装置。

【請求項3】

前記制御情報は、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することが可能な位置の情報を含み、

前記制御部は、当該情報に基づいて前記搬送部を制御する、
 ことを特徴とする請求項1に記載の半導体製造装置。

【請求項4】

前記キューテーブルには、ジョブ毎に、使用又は処理される物品の現在位置の情報がさらに登録され、

前記制御部は、

前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することが可能な位置の情報と前記ジョブ毎の使用又は処理される物品の現在位置の情報とに基づいて、前記次のジョブに後続するジョブにおいて使用又は処理される物品を、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送した後に、予め搬送することが可能な位置を算出し、

前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送した後に、前記後続するジョブにおいて使用又は処理される物品を前記算出した位置に予め搬送するように前記搬送部を制御する、

ことを特徴とする請求項 3 記載の半導体製造装置。

【請求項 5】

前記ジョブは、製造のためのジョブと点検のためのジョブとを含む、ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 項に記載の半導体製造装置。

【請求項 6】

前記半導体製造装置は、レチクルステージを含む露光装置であり、

前記物品は、前記レチクルステージにおいて使用されるレチクルである、
ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項に記載の半導体製造装置。

【請求項 7】

前記半導体製造装置は、基板ステージを含む露光装置であり、

前記物品は、前記基板ステージにおいて処理される基板である、
ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 項に記載の半導体製造装置。

【請求項 8】

請求項 6 又は請求項 7 に記載の前記露光装置を用いて基板を露光する工程と、
前記工程で露光された基板を現像する工程と、
を含むことを特徴とするデバイス製造方法。

【請求項 9】

半導体製造方法であって、

キューテーブルに基づいて、処理部において使用又は処理される物品を搬送する工程を含み、

前記キューテーブルには、前記処理部が実行しているジョブの次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送することを制御するための制御情報が登録され、

前記工程では、前記制御情報に基づいて、前記次のジョブにおいて使用又は処理される物品を予め搬送する、

ことを特徴とする半導体製造方法。